

第22回触媒化学融合研究センター講演会

産総研触媒化学融合研究センターでは、様々な分野で活躍している大学、公的研究機関、企業等の方々をお招きして、講演会を開催することで分野の垣根を越えた連携の実現を目指しています。多くの方々のご参加をお待ちしております。

「触媒的不斉合成に有用なP-キラルホスフィン配位子」

<講師>

千葉大学名誉教授

日本化学工業(株)研究開発本部技術顧問

今本 恒雄 先生

日時:2015年 8月 7日(金)16:00~17:30

場所:産総研第2事業所 情報棟1階 交流会議室1

(茨城県つくば市東1-1-1)



<講演概要>

光学活性ホスフィン配位子は遷移金属錯体触媒不斉合成において極めて重要な役割を担っており、これまでに多種多様な配位子が開発されてきた。本講演では不斉ホスフィン配位子の設計と合成および応用について概観し、リン原子上に不斉中心をもつホスフィン配位子に関する演者らの研究を紹介する。とりわけ、ホスフィン・ボランを用いる新規P-キラルホスフィン配位子の合成とキラル医薬品中間体の触媒的不斉合成への利用について詳述する。一方、より優れた不斉配位子の開発には、不斉触媒反応の機構に関する知見が欠かせない。ここでは、ロジウム錯体触媒不斉水素化の反応経路と立体選択性発現機構の解明に関する最近の研究成果についても言及する。

【問い合わせ先】 触媒化学融合研究センター 担当:白川

E-mail:irc3-kouenkai-ml@aist.go.jp TEL:029-861-2763

HP: <http://irc3.aist.go.jp/>